LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE AND ITS MANUFACTURE

Patent Number:

JP9113888

Publication date:

1997-05-02

Inventor(s):

KAWAMURA HIROMITSU; OBARA KATSUMI; KINUGAWA KIYOSHIGE

Applicant(s)::

HITACHI LTD

Requested Patent:

☐ JP9113888

Application Number: JP19950271402 19951019

Priority Number(s): IPC Classification:

G02F1/1335; G02B5/22

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To reduce the reflection factor and total transmissivity and to improve the contrast, black deepness and color purity by forming a film which has wavelength selective absorptivity on an upper glass substrate.

SOLUTION: The liquid crystal 3 is sandwiched between a couple of glass substrates 1 and 2 and the wavelength selecting light absorptive film 8 is formed as the base layer of a functional film group 4 formed on the liquid-crystal side surface of the upper glass substrate 1 by using at least one kind of oxide selected among silicon, zinc, and titanium as a principal component and adding a coloring component giving wavelength selective absorptivity thereto. Further, a wavelength selecting light absorptive film 9 is formed of similar materials on the top surface of an upper polarizing plate 6. Outside the lower glass substrate 2, i.e., on the reverse surface of a liquid crystal display device, what is called a backlight is arranged to lighten up the entire display surface of the liquid crystal display device. The films 8 and 9 are both provided to improve the contrast, black deposition, and color purity more.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-113888

(43)公開日 平成9年(1997)5月2日

(51) Int.Cl.6

識別記号

庁内整理番号

 \mathbf{F} I G 0 2 F

技術表示箇所

G02F 1/1335 5/22 G02B

500

G 0 2 B 5/22 500

1/1335

審査請求 未請求 請求項の数3 OL (全 8 頁)

(21)出願番号

特願平7-271402

(22)出廣日

平成7年(1995)10月19日

(71)出願人 000005108

株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地

(72)発明者 河村 啓滋

千葉県茂原市早野3300番地 株式会社日立

製作所電子デバイス事業部内

(72)発明者 小原 克美

千葉県茂原市早野3300番地 株式会社日立

製作所電子デパイス事業部内

(72)発明者 衣川 清重

千葉県茂原市早野3300番地 株式会社日立

製作所電子デパイス事業部内

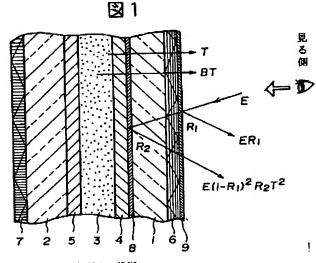
(74)代理人 弁理士 武 顕次郎

液晶表示装置とその製造方法 (54) 【発明の名称】

(57)【要約】

【課題】反射防止性能と髙コントラスト、黒沈みおよび 髙色純度の液晶表示装置を提供する。

【解決手段】構成材として、上下一対のガラス基板1. 2と、一対のガラス基板の間に設けたカラーフィルタ、 スイッチング素子、液晶、配向膜等からなる上機能性膜 群4、および一対のガラス基板にそれぞれ積層した上偏 光板9と下偏光板7とを少なくとも有し、一対のガラス 基板の少なくとも表示面を構成する上ガラス基板1の液 晶側表面、または上ガラス基板1の液晶側表面と上偏光 板9の表示面側表面に、珪素、亜鉛、チタンの中から選 ばれた少なくとも1種類の酸化物を主成分とし、これに 波長選択吸収性を呈する着色成分を添加してなる波長選 択光吸収性被膜8,9を形成したことを特徴とする。



1:上ガラス基板

2:下ガラス基板

3:液晶

: 上侧機能腱群

· 下側機能膜群

上側偏光板

7:下側偏光板

9: 波長選択光吸収性被膜

【特許請求の範囲】

【請求項1】構成材として、上下一対のガラス基板と、 前記一対のガラス基板の間に設けたカラーフィルタ、ス イッチング素子、液晶、配向膜、および前記一対のガラ ス基板にそれぞれ積層した上偏光板と下偏光板とを少な くとも有する液晶表示装置において、

前記一対のガラス基板の少なくとも表示面を構成する上 ガラス基板の液晶側表面、または前記ガラス基板の液晶 側表面と前記上偏光板の表示面側表面に、珪素、亜鉛、 チタンの中から選ばれた少なくとも1種類の酸化物を主 成分とし、これに波長選択吸収性を呈する着色成分を添 加してなる波長選択光吸収性被膜を備えたことを特徴と する液晶表示装置。

【請求項2】構成材として、上下一対のガラス基板と、 前記一対のガラス基板の間に設けたカラーフィルタ、ス イッチング素子、液晶、配向膜、および前記一対のガラ ス基板にそれぞれ積層した上偏光板と下偏光板とを少な くとも有する液晶表示装置の製造方法において、

珪素、亜鉛、チタンの中から選ばれた少なくとも1種類 のアルコキシドのアルコール溶液を、水、酸触媒の存在 20 下で加水分解し縮重合させてゾル液とし、前記ゾル液に 着色材を添加したものを前記上ガラス基板の液晶側表 面、または前記ガラス基板の液晶側表面と前記上偏光板 の表示面側表面に塗布し、加熱重合してゲル化すること により波長選択光吸収性被膜を形成することを特徴とす る液晶表示装置の製造方法。

【請求項3】請求項2において、前記着色材が、キサン テン系染料、アントラキノン系染料、フタロシアニン系 染料、トリフェノールメタン系染料、アゾ系染料、イン ジゴイド系染料、カルボニウムイオン系染料、および顔 30 料の中から選ばれた少なくとも1種であることを特徴と する液晶表示装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、液晶表示装置に係 り、特にコトラスト、黒沈みおよび色純度に優れた液晶 表示装置とその製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】液晶表示装置は、一般にその画像表示面 である上偏光板表面(外表面)が光沢状態となっている ので外光を反射し易くなり、コントラストが低下して表 示される絵や文字などの画像が読み難いという問題があ

る。

【0003】この問題は、情報機器の端末としての使用 上、オペレータの作業環境の問題として取上げられてお り、これらの事情から液晶表示装置の反射防止対策が強 く要求されている。

2

【0004】また、波長575nm~580nmの範囲 にある黄色味の光が混在して色純度の低下の原因となっ

【0005】反射防止対策として、上偏光板の表面にい 10 わゆるシリカスプレーコーティングをして、ノングレア 処理をするとか、多層膜をスパッターなどにより形成し て、光干渉による反射防止膜を設けるとかの方法が提案 されている。

【0006】なお、この種の反射防止膜に関する従来技 術を開示したものとしては、例えば特開昭61-120 121号公報を、また、陰極線管のパネル表面にシリカ 粒子の層を形成したものとして特開昭60-21874 7号公報を挙げることができる。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】上記したように、液晶 非装置における解決すべき課題として、(1)反射防止 によるコントラストの向上、(2) 非点灯部分の黒沈み の改善、(3)色純度の向上がある。

【0008】液晶表示装置の表示面の反射を防止するも のとして提案されている前記したシリカスプレーコート を施した例を説明する。

【0009】図8は従来の液晶表示装置の構成を模式的 に示した断面図であって、1は上ガラス基板、2は下ガ ラス基板、3は液晶、4は上側機能膜群、5は下側機能 膜群、6は上側偏光板、7は下側偏光板である。

【0010】上記上側機能膜群4は主としてカラーフィ ルタ、走査電極、配向膜からなり、下側機能膜群5は主 として薄膜トランジスタ、信号電極、配向膜からなる。 【0011】また、Eは外来光の強さ、R1は上側偏光 板6の反射率、R2 は上側ガラス基板1の反射率、Bは 光源(バックライト)の明るさ(輝度)、Tは全透過率 である。

【0012】同図に示した構成の液晶表示装置の場合、 そのコントラストCは次式(1)で定義される。

40 [0013]

【数1】

液晶表示装置の点灯部分の輝度(液晶表示装置の輝度+外来光反射輝度)

液晶表示装置の非点灯部分の輝度(外来光反射輝度)

• • • • • • • • (1)

【0014】そして、液晶表示装置の外表面の偏光板、 ここでは上側偏光板6の空気に対する反射率を R_1 、上 50 を T 、液晶表示装置の輝度を B (c d $\mathrm{/m}^2$)、外来光

側ガラス基板1の内部界面での反射率をR2、全透過率

3

の明るさをE(c d / m 2)としたとき、コントラスト C は次式(2)で算出される。

[0015]

【数2】

В

$$C = 1 + \frac{1}{E \{R_1 + (1 - R_1)^2 R_2 T^2\}}$$

【0016】この式(2)から、上側偏光板6の反射 「 ER_1 」と上側ガラス基板1の反射「E($1-R_1$) 2 R_2 T^2 」を小さくする手段を設ければコントラスト Cを大きくすることができることが分かる。

【0017】また、非点灯部分は、カラーフィルタの反射色や僅かな透過色、液晶やガラス基板の体色(ボディカラー)の色調の存在により、本来黒に見えるところが緑系の色に見え、所謂黒沈みの状態とはならないという問題があった。

【0018】さらに、点灯部分は、赤色フィルタと青色フィルタの中間色である黄色味がかった透過色がバックライトの当該色調の発光スペクトルで強調されるために、純度が劣化してしまうという問題があった。

【0019】また、従来から、スパッターなどにより形成した光干渉多層膜の反射防止膜のついたフィルムを貼り付ける方法もある。これは特性は優れているが、スパッター装置などの大がかりな製造設備を要し、価格が非常に高いものとなってしまう。

【0020】本発明の目的は、上記従来の諸問題を解消し、反射防止性能と高コントラスト性、高色純度性、低製造価格を同時に満足させる新規な構成をもつ液晶表示装置とその製造方法を提供することにある。

[0021]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するために、請求項1に記載の第1の発明は、構成材として、上下一対のガラス基板と、前記一対のガラス基板の間に設けたカラーフィルタ、スイッチング素子、液晶、配向膜、および前記一対のガラス基板にそれぞれ積層した上偏光板と下偏光板とを少なくとも有する液晶表示において、前記一対のガラス基板の少なくとも表示面を描述いて、前記一対のガラス基板の少なくとも表示面を構成する上ガラス基板の液晶側表面、または前記ガラス基板の液晶側表面と前記上偏光板の表示面側表面に、珪太の液晶側表面と前記上偏光板の表示面側表面に、珪、亜鉛、チタンの中から選ばれた少なくとも1種類の酸化物を主成分とし、これに波長選択吸収性を呈する着色成分を添加してなる波長選択光吸収性被膜を備えたことを特徴とする。

【0022】また、請求項2に記載の第2の発明は、構成材として、上下一対のガラス基板と、前記一対のガラス基板の間に設けたカラーフィルタ、スイッチング素る。 子、液晶、配向膜、および前記一対のガラス基板にそれぞれ積層した上偏光板と下偏光板とを少なくとも有する液晶表示装置の製造方法において、珪素、亜鉛、チタン50る。 4

の中から選ばれた少なくとも1種類のアルコキシドのアルコール溶液を、水、酸触媒の存在下で加水分解し縮重合させてゾル液とし、前記ゾル液に着色材を添加したものを前記上ガラス基板の液晶側表面、または前記ガラス基板の液晶側表面と前記上偏光板の表示面側表面に塗布し、加熱重合してゲル化することにより波長選択光吸収性被膜を形成することを特徴とする。

【0023】さらに、請求項3に記載の第3の発明は、上記第2の発明における前記着色材を、キサンテン系染 10 料、アントラキノン系染料、フタロシアニン系染料、トリフェノールメタン系染料、アゾ系染料、インジゴイド系染料、カルボニウムイオン系染料、および顔料の中から選ばれた少なくとも1種としたことを特徴とする。

[0024]

【発明の実施の形態】図1は本発明による液晶表示装置の基本構成を説明する模式断面図であって、1は上ガラス基板、2は下ガラス基板、3は液晶、4は上側機能膜群、5は下側機能膜群、6は上側偏光板、7は下側偏光板、8は上ガラス基板1の上側機能膜群4側に形成した波長選択光吸収性被膜、9は上側偏光板6の表面に形成した波長選択光吸収性被膜である。

【0025】なお、上側機能膜群4、下側機能膜群5、およびE、 R_1 、 R_2 、B、Tは前記図8と同様である。

【002·6】同図において、一対のガラス基板の間には 液晶3が挟持され、上側ガラス基板1の液晶側の面に形 成されている機能性膜群4の下地層として珪素、亜鉛、 チタンの中から選ばれた少なくとも1種類の酸化物を主 成分とし、これに波長選択吸収性を呈する着色成分を添 30 加してなる波長選択光吸収性被膜8が形成されている。

【0027】また、上側偏光板6の表面にも同様の材料からなる波長選択光吸収性被膜9が形成されている。

【0028】下側ガラス基板2の外面、すなわち液晶表示装置の裏面には、所謂バックライト(図示せず)が配置されていて、液晶表示装置の表示面の全面を照明するようになっている。

【0029】上記した波長選択光吸収性被膜8と9は、何れか一方にのみ、特に上側ガラス基板1にのみ形成してもよいが、両方を設けることでコントラスト、黒沈40 み、色純度をより向上できる。

【0030】そして、上記波長選択光吸収性被膜を構成するための着色材(波長選択光吸収性着色材)としては、キサンテン系染料、アントラキノン系染料、フタロシアニン系染料、トリフェノールメタン系染料、アゾ系染料、インジゴイド系染料、カルボニウムイオン系染料、および顔料の中から選ばれた少なくとも1種を用いる。

【0031】上側ガラス基板1にのみ上記波長選択光吸収性被膜8を設ける場合の製造方法は、下記の通りである。

【0032】すなわち、珪素、亜鉛、チタンの中から選 ばれた少なくとも1種類の金属アルコキシドのアルコー ル溶液を、水、酸(例えば、硝酸)触媒の存在下におい て加水分解し、縮重合させてゾル液とし、これに上記の 着色材を添加したものをスピンコート法、スプレーコー ト法、あるいはディップコート法、その他の塗布方法を 用いて上側ガラス基板の表面に塗布する。

【0033】塗布後、加熱重合を進めてゲル化させて波 長選択光吸収性被膜8を得る。

【0034】上記の波長選択光吸収性着色材は、上記し た有機染料、顔料の他に、ネオジユウム(Na2 O3) 等の無機酸化物も使用可能であるが、微量添加で効果が 非常に大きい有機染料が最適である。

【0035】また、珪素、亜鉛、チタンのアルコキシド としては、それぞれ、エチルシリケート、ジンクブトキ サイド、チタンテトラーイソプロポキシド等を使用する のが望ましい。この珪素、亜鉛、チタンのアルコキシド の中から選ばれた少なくとも1種類のアルコール溶液を 塗布した膜は、平滑であっても、またはコントラストを

【0036】また、添加する有機染料としては、キサン テン系染料、アントラキノン系染料、フタロシアニン系 染料、トリフェノールメタン系染料、アゾ系染料、イン ジゴイド系染料、カルボニウムイオン系染料が好適であ る。また、顔料を用いることもできる。

【0037】有機染料などの着色材すなわち光吸収材 は、その種類や分子構造により、耐光性(着色寿命)が 異なるが、一般に紫外線や日光に対して褪色や変色を起 こすものがある。これを防止するために、有機染料を添 加したゾル液を塗布した下地を形成し、その上に有機染 料を添加しないか、あるいは少量添加すると共に、紫外 線をより多く吸収する成分(例えば、TiO2, ZnO 等)を添加した被膜を形成した2層構造としてもよい。

【0038】なお、多層膜の場合は、光学膜厚(屈折率 ×物理膜厚)を適切に設定することで光の干渉作用によ る反射防止性を得ることができる。勿論、単層膜でもガ ラス基板よりも屈折率を小さくすれば反射防止性を得る ことができる。

【0039】このようにして、波長選択吸収性を有する 被膜8を上側ガラス基板に形成することによって、前記 式(2)に示した反射率R2と全透過率Tを小さくする ことができ、コントラスト、黒沈み、および色純度が向 上する。

【0040】さらに、上側偏光板6の表面にも上記と同 様の成分構成をもつ波長選択吸収性を有する被膜9を形 成することにより、反射率R₁、R₂ および全透過率T がさらに小さくなり、図1に示したように、外光Eの入 射に対する上側偏光板6の反射量ER1 と上側ガラス基 板 1 の反射量E $(1-R_1)^2$ R_2 T^2 が低減し、コン 50 き、有機系顔料としては、アゾ顔料、フタロシアニン、

6 トラスト、黒沈み、および色純度を大幅に向上させるこ

【0041】なお、本発明は、液晶表示装置の基板とし てガラス基板を用いたものに限るものではなく、ガラス 基板に代えてプラスチック板、プラスチックフィルム等 のプラスチック材を用いたものにも同様に適用できるも のである。

[0042]

【実施例】以下、本発明による液晶表示装置の一実施例 10 を説明する。

【0043】本発明による波長選択吸収性被膜を形成す る基体は前記したガラス基板、および偏光板であるが、 その対象がプラスチック材である場合は、その主成分と して、ポリエチレン、ポリプロピレン、ウレタン、アク リル、フェノール、エポキシ、メラニン、ナイロン、ポ リイミド、ポリカーボネート、ブチル、エポキシフェノ ール、塩化ビニール、ポリエステル等を用いたものが挙 げられる。

【0044】ガラス基板を用いた場合には、当該基板と 損なわない程度の僅かな凹凸を有していても差し支えな 20 の濡れ性を考慮するならば、アルカリ処理やフッソ処理 等の前処理を施すことが望ましい。

> 【0045】また、プラスチック材料を対象とする場合 の上記前処理は、中性洗剤を用いた洗浄を施すのがよ く、さらに、当該プラスチック材料に対する官能基を有 するカップリング材を併用するのが望ましい。

【0046】この波長選択吸収性被膜を形成する基体が ガラス基板である場合には、Si(OR)4を溶解した アルコールを含むゾル液に所定量の有機染料および/ま たは顔料を添加した塗布液を準備し、波長選択吸収性被 膜を形成する基体がプラスチック板の場合には、このプ 30 ラスチックを構成する高分子体と容易に反応する官能基 とSi (OR) x (但し、Xは2~4、好ましくは3) を保有するシランカップリング剤、あるいは上記Si

(OR)₄ とシランカップリング剤との混合溶液を溶解 したアルコールを含むゾル液に、所定量の有機染料およ び/または顔料を添加した塗布液を準備する。

【0047】そして、上記の溶液中に少量のH2O、酸 性触媒を添加することにより、金属アルコキシドの分解 を促進させたり、造膜性、粘結性を向上させる。

40 【0048】本実施例で用いる有機染料としては、キサ ンテン系染料、アントラキノン系染料、フタロシアニン 系染料、トリフェノールメタン系染料、アゾ系染料、イ ンジゴ系染料、カルボニウムイオン系染料、など、多く の染料を用いることができる。なお、無機染料を使用す ることもできる。

【0049】また、顔料を単独で、または上記の染料と 併用しても良い。顔料は、無機系顔料として、酸化物、 水酸化物、カーポンブラック、クロム酸、炭酸塩、珪酸 塩、燐酸塩、フェロシアン化物、金属粉、等が使用で

7

縮合多環顔料、等を使用することができる。

【0050】これらの着色材(光吸収材)の種類と添加 量は、目的とする色調、光吸収性能に応じて決定する。

【0051】このようにして作成した波長選択光吸収性能を有する被膜形成用溶液は、室温または60°C以下の温度で膜形成基体(ガラス基板、あるいは偏光板)に塗布される。

【0052】この塗布は、スピンコート法、スプレー法、ディッピング法あるいはこれらの組み合わせで行う。

【0053】膜形成基体の表面に塗布した後、塗布被膜を硬化するために、その塗布面を100°C~200°Cで加熱することが望ましい。しかし、成分の分解は室温においても徐々に進行するので、液晶表示装置を構成する各部材の許容温度範囲内で熱処理すればよい。

【0054】この波長選択光吸収性被膜を前記した2層 構造とした場合は、第2層を塗布する前に、第1層を加 熱するか、または第2層を塗布した後に第1層と共に同 時加熱を施してもよい。

【0055】図2は本発明による液晶表示装置の1実施例における当該液晶表示装置を構成する波長選択光吸収性被膜とカラーフィルタの分光透過率およびバックライトの分光スペクトルの説明図であって、横軸に波長(nm)を、縦軸に透過率と発光強度(相対値)を取って示す。

【0056】同図において、 は上ガラス基板に形成した波長選択光吸収性被膜の分光透過率曲線、 . .

はそれぞれ赤色フィルタ、緑色フィルタ、青色フィルタ の各分光透過率曲線、 はバックライトの発光スペクト ル分布曲線を示す。

【0057】点灯部分では赤色フィルタの分光透過率曲線 と緑色フィルタの分光透過率曲線 が交差するB点付近の波長の光は、それらの中間色である黄色の色調の透過色を示し、これがバックライトの発光強度のピークの1つであるC点近傍の波長の光によって強調される。そのため、黒沈みが不十分で、色純度が損なわれる。しかし、本発明による波長選択光吸収性被膜は図中のA点近傍に光吸収領域を有するため、上記した黄色味の透過光の強度が抑制され、その結果、黒沈みが十分となり、色純度が向上する。

【0058】上記波長選択光吸収性被膜は、上ガラス基板の液晶側にのみ設けても上記の効果が得られるが、さらに上側偏光板の表面にも同様の波長選択光吸収性被膜を形成することで、十分な黒沈みと色純度向上が達成される。

【0059】図3は本発明による波長選択光吸収性被膜の具体的構成例とその効果を従来技術と比較した説明図であって、図中1は波長選択光吸収性被膜を有しない従来の液晶表示装置、2~7は本発明の各種の具体例である。

8

【0060】従来技術の液晶表示装置のコントラストは約10(同図では、9.6)と低く、黒沈みは不完全で、色純度は黄色味の混在が見られた。

【0061】これに対し、本発明の例2~7では、波長選択光吸収性被膜が波長選択光吸収性を有すると共に反射防止性能も有しているので、コントラストは最低でも11、最高では51となっている。

【0062】また、黒沈みおよび色純度も良好な結果が得られている。特に、例5と例6および例7は波長選択10 光吸収性被膜を2層構造とし、膜厚を正確に制御して光の干渉を利用した反射防止製造も備えているため、反射率R1 は極めて小さく、特に例7はガラス基板と偏光板の両方に2層構造の波長選択光吸収性薄膜をつけてあるので、反射率R2 も小さくなり(全透過率Tは輝度の低下を防止ため、両膜で80%になるように調整)、コントラストは例1に比較して2~5.0倍向上しているのが分かる。

【0063】このように、本発明の波長選択光吸収性被膜を備えることにより、コントラスト、黒沈みおよび色 20 純度はすべて良好なものとなり、高品質の画像表示が可能な液晶表示装置を提供できる。

【0064】図4は本発明による液晶表示装置を用いて 組み立てたTFT型液晶表示モジュールの構造例を説明 する展開斜視図である。

【0065】同図において、MDLは液晶表示モジュール、SHDは上フレームである金属製のシールドケース、WDは液晶表示モジュールの有効画面を画定する表示窓、PNLは液晶表示素子からなる液晶表示パネル、PCB1はドレイン側回路基板、PCB2はゲー側回路 がいるが、PCB3はインターフェース回路基板、PRSはプリズムシート、SPSは拡散シート、GLBは導光板、RFSは反射シート、LPはバックライトBLのランプを構成する蛍光管、LSは反射シート、GCはゴムブッシュ、LPCはランプケーブル、MCAは導光板GLBを設置する開口MOを有する下側ケース、JN1.2、3は回路基板間を接続するジョイナ、TCP1、2はテープキャリアパッケージ、INS1、2、3は絶縁シート、GCはゴムクッション、BATは両面粘着テープ、ILSは遮光スペーサである。

40 【0066】上記の各構成材は、金属製のシールドケースSHDと下側ケースMCAの間に積層されて挟持固定されて液晶表示モジュールMDLを構成する。

【0067】液晶表示パネルPNLは本発明により処理された波長選択光吸収性被膜を形成した上ガラス基板および/または上側偏光板を備えており、その周辺に各種の回路基板を取り付けて画像表示のための駆動がなされる。

【0068】また、液晶表示パネルPNLの裏面には導 光板GLBに各種の光学シートを積層してなる背面照明 50 構造と蛍光管LPとで構成したバックライトBLが設置 9 され、液晶表示パネルPNLに形成された画像を照明して表示窓WDに表示する。

【0069】図5は本発明が適用されるアクティブ・マトリクス方式カラー液晶表示装置の一画素とその周辺を示す平面図である。

【0070】同図に示すように、各画素は隣接する2本の走査信号線(ゲート信号線または水平信号線)GL (ゲートライン)と、隣接する2本の映像信号線(ドレイン信号線または垂直信号線)DL (データライン)との交差領域内(4本の信号線で囲まれた領域内)に配置されている。

【0071】各画素は薄膜トランジスタTFT(TFT 1. TFT2)、透明な画素電極ITO1および保持容 量素子Cadd (付加容量)を含む。走査信号線GLは図 では左右方向に延在し、上下方向に複数本配置されてい る。また、映像信号線DLは上下方向に延在し、左右方 向に複数本配置されている。

【0072】なお、SD1はソース電極、SD2はドレイン電極、BMはブラックマトリクス、FILはカラーフィルタである。

【0073】また、図6は図5のL1-L1線で切断した断面図であって、液晶3を基準にして下ガラス基板2側には薄膜トランジスタTFTおよび透明画素電極ITO1等の下側機能膜群5が形成され、上ガラス基板1側にはカラーフィルタFIL、遮光膜すなわちブラックマトリクスBM等の上側機能膜群4が形成されている。この上ガラス基板1を一般に走査側基板(あるいは、カラーフィルタ基板)と称する。

【0074】上ガラス基板1、下ガラス基板2の両面にはディップ処理等によって形成された酸化シリコン膜SIOが設けられている。

【0075】上ガラス基板1の内側(液晶層LC側)の表面には、波長選択光吸収性被膜8が設けてあり、その上にブラックマトリクスBM、カラーフィルタFIL、保護膜PSV2、共通透明画素電極ITO2(COM)および上部配向膜ORI2からなる上側機能性膜群4がが順次積層して設けられている。

【0076】そして、上側偏光板6の上面にも波長選択 光吸収性被膜9は形成されている。上記した各種の電極 を含む薄膜の成膜とパターニングは、主として紫外線を 用いたマスク露光とエッチング処理等の湿式現像により 行われる。

【0077】図7は本発明による液晶表示素子を用いた液晶表示モジュールを組み込んだ電子機器の一例を説明する携帯型パソコンの外観図であって、図4と同一符号は同一部分に対応する。

【0078】この携帯型パソコンは、キーボードを搭載 しホストCPUを内蔵した本体部と液晶表示モジュール MDLを実装しインバータ電源 I Vを内蔵した表示部と から構成され、両者はヒンジを連絡するケーブルにより 結合されている。

【0079】また、表示部には各種の調整ボタンCT、TCON、CR等が設けられており、キーボードとホストからの信号は矢印に示したように流れて表示部に表示される。

【0080】本発明を適用して製造した液晶表示素子を 用いることにより、高画質の画像表示を行うことができ る。

10 [0081]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、外来光の反射を効果的に抑制することができ、また、特定波長の透過光の強度を選択的に低減できるので、表示画像の見易さ、コントラスト、黒沈み、色の鮮やかさ等の表示品質を向上させることができ、且つ、低コストで製造することの出来る液晶表示装置とその製造方法を提供することが出来る。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明による液晶表示装置の基本構成を説明す 20 る模式断面図である。

【図2】本発明による液晶表示装置の1実施例における 当該液晶表示装置を構成する波長選択光吸収性被膜とカ ラーフィルタの分光透過率およびバックライトの分光ス ペクトルの説明図である。

【図3】本発明による波長選択光吸収性被膜の具体的構 成例とその効果を従来技術と比較した説明図である。

【図4】本発明による液晶表示装置を用いて組み立てた TFT型液晶表示モジュールの構造例を説明する展開斜 視図である。

30 【図5】本発明が適用されるアクティブ・マトリクス方式カラー液晶表示装置の一画素とその周辺を示す平面図である。

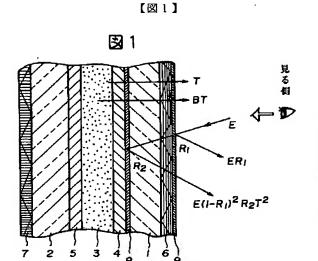
【図6】図5のL1-L1線で切断した断面図である。

【図7】本発明による液晶表示素子を用いた液晶表示モジュールを組み込んだ電子機器の一例を説明する携帯型パソコンの外観図である。

【図8】従来の液晶表示装置の構成を模式的に示した断面図である。

【符号の説明】

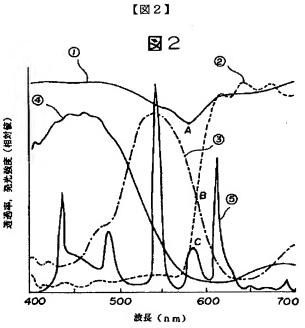
- 10 1 上ガラス基板
 - 2 下ガラス基板
 - 3 液晶
 - 4 上側機能膜群
 - 5 下側機能膜群
 - 6 上側偏光板
 - 7 下側偏光板
 - 8 上ガラス基板に形成した波長選択光吸収性被膜
 - 9 上側偏光板に形成した波長選択光吸収性被膜。



1:上ガラス基板 2:下ガラス基板

3:液晶

3:於明 4:上旬機能膜群 5:下旬機能膜群 6:上旬傷光板 7:下旬傷光板 8,9:波長選択光吸収性被膜



【図4】

[図3] 図3

		従来例		本 発	明			
		1	2	3	4	5	6	7
酸形成 基 板		_	ガラス基板 (1度)	ガラス基板 (2度)	個光板 (1差)	個光板 (2層)	傷光板 (2場)	ガラス等を 個光板 (2個)
装得成	下地	_	SiOg	SIO ₂ +光吸収制	SiOg	5i0g +光极収料	SIO。 +TiD。 +光表來報	510、+ Tie, +光吸収4 (商基框共
	上地	_	+先吸収有	SiO ₂	+光吸収材	SIO _E	SIO	SiQ _g 陳基氨共
光学特性	Rx (%)	5.5	5.5	5.5	5.5	2.0	0.3	0.3
	R ₄ (%)	4.2	4.2	2.0	4.2	4.2	4.2	2.0
	T (%)	юо	80	80	80	80	80	80
表示品質	の抗常	9.6	11	13	11	18	28	51
	無 处み	不完全	良好	良好	良好	良好	人好	非常に 良好
	ana	黄色味 混在	魚好	良好	良好	良好	良好	非常に良好
日 (地面舞在) (cd/㎡)		80 .						
ディを (外来算度) (ペ/㎡)		100						

